

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成31年2月28日(2019.2.28)

【公開番号】特開2018-87921(P2018-87921A)

【公開日】平成30年6月7日(2018.6.7)

【年通号数】公開・登録公報2018-021

【出願番号】特願2016-231491(P2016-231491)

【国際特許分類】

G 0 9 F	9/00	(2006.01)
H 0 1 L	51/50	(2006.01)
H 0 5 B	33/02	(2006.01)
H 0 5 B	33/10	(2006.01)
G 0 2 F	1/13	(2006.01)
G 0 2 F	1/1333	(2006.01)

【F I】

G 0 9 F	9/00	3 3 8
H 0 5 B	33/14	A
H 0 5 B	33/02	
H 0 5 B	33/10	
G 0 2 F	1/13	1 0 1
G 0 2 F	1/1333	5 0 0

【手続補正書】

【提出日】平成30年12月21日(2018.12.21)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 5 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 5 3】

上記第1の実施の形態で説明したのと同様にして、保護層14まで形成した後、支持基板9の裏面S2に高粘度材料32を塗布する。これにより、支持基板9の裏面S2が高粘度材料32に接触するようになる。続いて、支持基板9の裏面S2を高粘度材料32に接触させた状態で、支持基板9の裏面S2側からレーザ光Lを照射する。この後、高粘度材料32を除去し、支持基板9を可撓性基板11から剥離する。